

证券代码：920186

证券简称：中科仪

公告编号：2026-079

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

伴随国内集成电路产业快速发展，半导体装备核心零部件国产化需求持续攀升，集成电路干式真空泵市场空间稳步扩容。为顺应行业市场需求变化，匹配公司中长期经营发展战略，公司拟使用自筹资金实施集成电路干式真空泵扩产项目。公司计划在已有募投项目“干式真空泵产业化建设项目”和“高端半导体设备扩产项目”基础上，实施集成电路干式真空泵扩产项目，旨在提升干式真空泵核心零部件自主制造能力，降低外协依赖，优化产品成本结构，从而提升整体盈利水平。项目资金来源为自筹资金，项目拟投资 42,313.48 万元，其中中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司及上海分公司拟投资 19,144.70 万元，实施主体为：中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司；中科仪（南通）半导体设备有限责任公司拟投资 23,168.78 万元，实施主体为：中科仪(南通)半导体设备有限责任公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

（一）独立董事专门会议审议意见

2026年10月16日，公司召开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于审议公司对外投资开展集成电路干式真空泵扩产项目的议案》，同意公司开展集成电路干式真空泵扩产项目，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议意见

2026年10月19日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于审议公司对外投资开展集成电路干式真空泵扩产项目的议案》，同意公司开展集成电路干式真空泵扩产项目，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）董事会审议意见

2026年10月19日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于审议公司对外投资开展集成电路干式真空泵扩产项目的议案》，同意公司开展集成电路干式真空泵扩产项目。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资项目的具体内容

1、项目名称：集成电路干式真空泵扩产项目

2、项目实施主体：中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司、中科仪(南通)半导体设备有限责任公司。

3、项目投资规模：以自筹资金进行投资，项目投资规模为 42,313.48 万元，其中中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司及上海分公司拟投资 19,144.70 万元，中科仪(南通)半导体设备有限责任公司拟投资 23,168.78 万元。

4、项目具体内容：本扩产项目拟在沈阳、南通及上海三地实施，其中，沈阳和南通主要围绕集成电路干式真空泵开展产业化扩产建设，通过新建加工中心厂房、新增及升级生产、装配、检测测试等相关设备和设施，进一步提升干式真空泵规模化生产能力；上海分公司主要围绕干式真空泵相关零部件加工制造环节，通过新增机械加工、检测、清洗及自动化等设备，提升核心零部件加工制造能力。

5、项目建设期：项目建设期为 3 年。

6、投资进度：本次新增项目预计建设期为 3 年，其中第一年投资金额为 33,649.00 万元，第二年投资金额为 7,670.81 万元，第三年投资金额为 993.67 万元。

7、可行性：

（1）半导体设备投资持续增长，为本项目新增产能消化提供较好的市场基础

干式真空泵是半导体多个制程中的通用真空设备，公司相关产品应用场景覆盖单晶拉晶、Load-Lock、刻蚀、CVD、ALD、封装、测试等清洁或严苛制程。在晶圆制造领域，以 12 英寸晶圆生产线为例，每 3.5 万片/月产能约需配置 2,000 台真空泵，晶圆制造新增产能、工艺设备扩充及存量设备更新能够形成较大的干式真空泵需求。

从行业投资看，全球半导体设备投资仍处于较高景气水平。SEMI 数据显示，2025 年全球半导体设备市场规模为 1,347 亿美元，同比增长 15%。受益于人工智能赛道需求的持续走高，预计 2026 年这一规模将增长至 1,659 亿美元，2027 年将突破 2,000 亿美元。国内半导体设备产业布局逐步完善，产业进入发展快车道。根据 SEMI 及中商产业研究院数据，2025 年中国半导体设备行业市场规模达 3,755 亿元，同比增长 10%；随着晶圆产能释放与国产化替代深化，预计 2026 年将增至 4,131 亿元。

随着 AI 算力基础设施建设、先进存储扩产及国内晶圆制造能力持续提升，

下游半导体设备投资有望为干式真空泵市场提供持续支撑，本项目新增产能具有较为充足的市场空间。

（2）公司已形成生产制造、技术研发及客户资源等综合优势，为本项目顺利实施奠定坚实基础

公司长期从事干式真空泵研发、生产和销售，已具备成熟的产业化基础。随着南通生产基地建成投产，公司已形成沈阳、南通两地干式真空泵生产布局，并在长期规模化生产过程中积累了较为丰富的生产工艺、质量控制和供应链管理經驗。本项目将继续在沈阳和南通实施干式真空泵扩产，同时在上海提升相关零部件加工制造能力，属于在公司既有生产制造体系上的进一步扩充，可充分利用现有生产资源、制造工艺及产业化经验。

在技术研发方面，公司专注于洁净真空、超高真空等技术研究和發展，拥有真空技术装备国家工程研究中心、国家真空仪器装置工程技术研究中心、国家企业技术中心等研发平台。截至 2026 年 6 月 30 日，公司及下属子公司已获授权专利 131 项，其中发明专利 110 项、实用新型专利 20 项、外观专利 1 项，获得软件著作权 36 项，较为完善的技术积累能够为本项目规模化生产及后续产品迭代提供有力支撑。

在客户资源方面，集成电路干式真空泵产品验证周期较长，下游客户对产品性能、可靠性、工艺适配及供应商持续服务能力具有较高要求。公司长期深耕干式真空泵领域，产品质量、研发与技术服务能力、产品线、品牌等获得了下游客户的充分认可，并与国内各大知名客户建立了良好的合作关系，形成了较为稳定的客户基础和持续获取订单的业务能力。依托现有客户资源、产品验证基础及持续拓展的市场应用，公司具备进一步承接客户新增采购需求的有利条件，有助于为本项目建成后的产能逐步释放和消化提供市场支撑。

本项目是在公司现有集成电路干式真空泵业务基础上的进一步扩产，在生产制造、技术积累、客户资源及产业化经验等方面均具备较好的实施条件；同时，通过沈阳、南通整机扩产与上海加工制造能力建设相结合，可进一步强化加工制造环节与整机生产环节之间的协同，提高公司整体生产制造及规模化交付能力，为本项目建设及新增产能消化提供坚实基础。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源为公司自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资主要为固定资产投资，公司将结合项目方案与设备供应商签订相关设备采购协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、技术迭代及产品升级风险

集成电路干式真空泵属于技术密集型产品，其性能、可靠性及工艺适配能力直接影响下游客户生产设备的稳定运行。随着集成电路制造工艺持续迭代，不同制程环节对干式真空泵的抽气性能、耐腐蚀性、耐粉尘能力、稳定性及能耗水平等提出更高要求。若公司未能准确把握行业技术发展趋势和客户需求变化，或未能及时完成产品技术升级和工艺适配，可能导致相关产品在性能、可靠性等方面无法满足客户需求，进而对本项目产品的市场竞争力及预期效益产生不利影响。

2、市场需求波动风险

本项目产品主要应用于集成电路晶圆制造及封装测试等领域，其市场需求与下游行业景气度、资本性支出、产能建设进度及设备投资节奏密切相关。若未来宏观经济、半导体行业景气度或下游客户资本开支发生不利变化，可能导致客户新增产能建设放缓、设备采购需求下降或订单执行进度延后。此外，行业技术路线变化、市场竞争加剧以及客户需求结构调整等因素，亦可能对干式真空泵的需求规模和产品结构产生影响，从而导致本项目新增产能消化不及预期，并对项目收入、利润及投资回收产生不利影响。

3、专业人才引进及流失风险

干式真空泵的研发、生产制造及客户工艺适配对研发、工艺、生产及技术

服务人员的专业能力和行业经验要求较高。随着国内半导体设备行业持续发展，行业内对高水平专业人才的竞争日趋激烈。公司已形成较为完善的人才招聘、培养和管理体系，并建立了具备一定专业技术积累和行业经验的人才队伍，但随着本项目实施及公司业务规模扩大，对相关专业人才的需求将进一步增加。若未来公司无法持续引进和培养符合业务发展需要的人才，或核心技术及管理人员出现较大规模流失，可能对本项目实施及公司持续经营产生不利影响。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次以自筹资金投资“集成电路干式真空泵扩产项目”系在公司募投项目“干式真空泵产业化建设项目”和“高端半导体设备扩产项目”的基础上实施的扩产建设，即在公司现有干式真空泵产品、技术及产业化基础上，进一步扩大集成电路干式真空泵生产能力，并同步提升干式真空泵核心零部件自主加工制造能力。项目达产后预计将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极作用。

五、备查文件

（一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

（二）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》

（三）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届独立董事专门会议第一次会议决议》

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2026年10月20日